

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成17年9月8日(2005.9.8)

【公表番号】特表2001-507135(P2001-507135A)

【公表日】平成13年5月29日(2001.5.29)

【出願番号】特願平10-528730

【国際特許分類第7版】

G 02 B 5/20

G 02 B 5/22

G 02 B 5/26

G 09 F 9/313

H 01 J 11/02

【F I】

G 02 B 5/20

G 02 B 5/22

G 02 B 5/26

G 09 F 9/313 Z

H 01 J 11/02 E

【手続補正書】

【提出日】平成17年1月24日(2005.1.24)

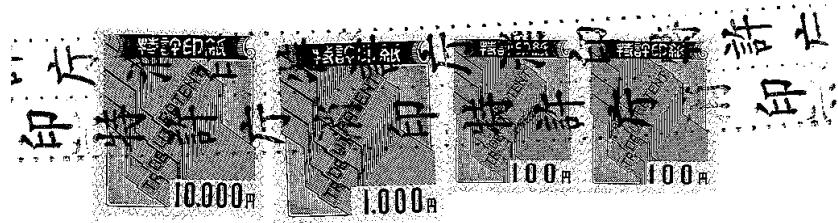
【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】補正の内容のとおり

【補正方法】変更

【補正の内容】



手 続 極 正 書



(¥11,200)

平成17年 1月24日

特許庁長官 小川 洋 殿

1 事件の表示

平成10年 特許願 第528730号

2 補正をする者

名 称 オプティカル コーティング ラボラトリー
 インコーポレイテッド

3 代 理 人

住 所 東京都千代田区霞が関3丁目2番4号
 霞山ビルディング7階 電話(3581)2241番(代表)
 氏 名 (7205) 弁理士 杉 村 興 作



4 補正により増加する請求項の数 7

5 補正対象書類名 請求の範囲

6 補正対象項目名 請求の範囲

7 補正の内容 別紙の通り



1. 請求の範囲を下記の通りに補正する。

「
 請 求 の 範 囲

1. プラズマディスプレイパネルのビューリング面の前方に配置する装置において、

この装置が、

前記プラズマディスプレイパネルに衝撃抵抗を与える少なくとも一つのプラスチック基板層と、

前記プラズマディスプレイパネルから放出される可視光波長よりも長い波長に相当するエネルギーを遮断する吸収層と、

良好な導電性を有する光選択層であって、この光選択層を電気的に接地する手段が設けられている当該光選択層と
を具えている装置。

2. 請求の範囲1に記載の装置において、前記光選択層が、プラスチック基板層上に堆積されている装置。

3. 請求の範囲2に記載の装置において、前記吸収層は、前記プラスチック基板層内に染料材を導入することにより形成した装置。

4. 請求の範囲3に記載の装置において、この装置が更に前記光選択層上に堆積された第1の反射防止被膜層を有している装置。

5. 請求の範囲4に記載の装置において、この装置が更に前記プラスチック基板層の表面上に堆積された第2の反射防止被膜層を有している装置。

6. 請求の範囲5に記載の装置において、前記第2の反射防止被膜層は導電性である装置。

7. プラズマディスプレイパネルのビューリング面の前方に配置する装置において、

この装置が、

第1の基板層と、

この第1の基板層に対し平行に面して配置された第2の基板層と、

前記第1の基板層と前記第2の基板層との間のプラスチック基板層と、

このプラスチック基板層に導入した吸収層と、

導電性を有する光選択層であって、この光選択層を電気的に接地する手段が設けられている当該光選択層と
を具えている装置。

8. 請求の範囲7に記載の装置において、前記第1の基板層がガラスである装置。

9. 請求の範囲8に記載の装置において、前記第2の基板層がガラスである装置。

10. 請求の範囲 9 に記載の装置において、前記光選択層は、ガラスより成る前記第 1 の基板層及び前記第 2 の基板層のうちの一方の基板層の表面上に堆積され、この表面は他方の基板層の対向面に面している装置。
11. 請求の範囲 7 に記載の装置において、前記光選択層が前記プラスチック基板層の表面上に堆積されている装置。
12. 請求の範囲 10 に記載の装置において、前記吸收層が更に選択色補正特性を有している装置。
13. プラズマディスプレイパネルのビューアイ面の前方に配置する装置において、

この装置が、

ビューアイ面と後面とを有する第 1 のガラス基板層と、

この第 1 のガラス基板層の後面に面する前面と、プラズマディスプレイパネルのビューアイ面の前方に配置するパネル対向面とを有する第 2 のプラスチック基板層と、

前記第 1 のガラス基板層と前記第 2 のプラスチック基板層との間の接着剤層と、

前記プラズマディスプレイパネルから放出される可視光波長よりも長い波長に相当するエネルギーを遮断するために、前記接着剤層内に導入された染料材を構成する吸收層と、

導電性が高い光選択層であって、この光選択層を電気的に接地する手段が設けられている当該光選択層と
を具えている装置。

14. プラズマディスプレイパネルのビューアイ面の前方に配置する装置において、

この装置が、

ビューアイ面と後面とを有する第 1 のガラス基板層と、

この第 1 のガラス基板層の後面に面する前面と、プラズマディスプレイパネルのビューアイ面の前方に配置するパネル対向面とを有する第 2 のプラスチック基板層と、

前記第 1 のガラス基板層と前記第 2 のプラスチック基板層との間の接着剤層と、

前記プラズマディスプレイパネルから放出される可視光波長よりも長い波長に相当するエネルギーを遮断するために、前記第 2 のプラスチック基板層内に導入された染料材を構成する吸收層と、

導電性が高い光選択層であって、この光選択層を電気的に接地する手段が設けられている当該光選択層と

を具えている装置。

15. プラズマディスプレイパネルのビューリング面の前方に配置する装置の製造方法において、

この製造方法が、

前記プラズマディスプレイパネルに衝撃抵抗を与える少なくとも一つのプラスチック基板層を形成する工程と、

前記プラズマディスプレイパネルから放出される可視光波長よりも長い波長に相当するエネルギーを遮断する吸収層を形成する工程と、

良好な導電性を有する光選択層を形成する工程と、

この光選択層の周辺エッジと接触するように導電性の接着テープを配置することにより、この光選択層を電気的に接地する手段を形成する工程とを具えている製造方法。

16. プラズマディスプレイパネルのビューリング面の前方に配置する装置において、

この装置が、

前記プラズマディスプレイパネルに衝撃抵抗を与える少なくとも一つのプラスチック基板層と、

前記プラズマディスプレイパネルから放出される可視光波長よりも長い波長に相当するエネルギーを遮断する吸収層と、

導電性を有する光選択層であって、この光選択層を電気的に接地する手段が設けられている当該光選択層と

を具えている装置。

17. プラズマディスプレイパネルのビューリング面の前方に配置する装置において、

この装置が、

前記プラズマディスプレイパネルに衝撃抵抗を与える少なくとも一つの基板層と、

連続的な導電性と、近赤外線領域内の反射性とを有する光選択層であって、この光選択層を電気的に接地する手段が設けられている当該光選択層とを具えている装置。

18. プラズマディスプレイパネルのビューリング面の前方に配置する装置において、

この装置が、

前記プラズマディスプレイパネルに衝撃抵抗を与える少なくとも一つの基板層と、

前記プラズマディスプレイパネルから放出される可視光波長よりも長い波長

に相当するエネルギーを遮断する赤外線遮断層と、

可視光透過性と、連続的な導電性とを有する光選択層であって、この光選択層を電気的に接地する手段が設けられている当該光選択層と
を具えている装置。

19. 請求の範囲 18 に記載の装置において、前記光選択層が近赤外線領域内の反射性を有している装置。

20. プラズマディスプレイパネルのビューリング面の前方に配置する装置において、

この装置が、

前記プラズマディスプレイパネルに衝撃抵抗を与える少なくとも一つの基板層と、

導電性と、10 オーム/□よりも小さい抵抗率とを有する光選択層であって、この光選択層を電気的に接地する手段が設けられている当該光選択層と
を具えている装置。

21. 請求の範囲 20 に記載の装置において、抵抗率を 5 オーム/□よりも小さくした装置。」